

令和3年12月9日

会員各位

公益社団法人 応用物理学会  
次世代リソグラフィ技術研究会  
幹事長 井谷 俊郎

## 第1回定例会開催通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、次世代リソグラフィ技術研究会の第3回定例会のご案内が出来ましたので、お送りさせていただきます。新型コロナウイルスの影響でオンライン定例会になります。今回の定例会につきましては、事前登録の必要はございません。当日お時間になりましたら、下記へ直接アクセスしてください。追記に注意事項を記載いたしましたので、ご確認ください。

また、出来るだけ多くの方に参加していただきたいので法人会員の方は社内での回覧も併せてお願いいたします。 敬具

記

1. 開催日時：令和4年 1月 27日（木） 定例会：13:00 – 17:00

2. 開催場所：オンライン定例会（Zoomでのライブ配信）  
※参加希望の方は、事務局へお問合せ下さい。

3. 参加費： 会員：無料

4. プログラム：「MNC, ナノテストシンポジウム, 計測特集」

13:00～13:05	『開会の挨拶』 大阪大学 井谷 俊郎氏
13:05～13:40	『MNC2021 EUVL Stochastics Symposium: Overcoming the Challenge of Stochastics for High Resolution EUV Lithography 概要報告』 東京エレクトロン 永原 誠司氏
13:40～14:15	『Advanced high throughput e-beam inspection with DirectScan 』 PDF Solutions, Marcin Strojwas 氏
14:15～14:50	『集積シリコン量子ビット作製に向けた電子線リソグラフィ技術の開発 』 産業技術総合研究所 加藤 公彦氏
14:50～15:05	～ 休憩 ～
15:05～15:30	『Measurability analysis of the HAR structure in 3D memory by T-SAXS simulation』 キオクシア 佐々木 香織氏

15:30～16:05	『電子線マスク描画装置におけるブランクス表面帯電効果の補正』 ニューフレアテクノロジー 野村 春之氏
16:05～16:40	『欠陥形状評価 SEM「CT1000」に適用した傾斜観察技術』 日立ハイテク 家田 雅常氏

以上

- 追記：・録画や録音は禁止させていただきます。
- ・発表者以外はミュートをお願いいたします。
  - ・参加者を明らかにするため、ログイン名を所属+名前に変更ください。  
#参加者リストで自分の名前にマウスを合わせ「詳細」をクリックすると  
#名前を変更できます。

また、ご不明な点がございましたら下記担当者までお問い合わせ下さるようお願い致します。

事務局：公益社団法人 応用物理学会

次世代リソグラフィ技術研究会担当／相良（サガラ） 好美

TEL(携帯)：090-5403-1147

E-mail: ngl@jsap.or.jp